

**ADVANTEST**<sup>®</sup>

MVM-SEM<sup>®</sup>

# E3630

次世代フォトマスク対応の多次元観察・測長SEM



E3630は、次世代フォトマスク向けに開発されたMVM-SEM\*です。新たに開発した対物レンズと低振動プラットフォームの採用により、従来システムに比べて測定性能が大幅に向上。さらに、マルチチャンネル型の検出システムと独創的な測定アルゴリズムの採用により、ハードマスクなどの薄膜プロセスを安定かつ高精度に測定します。また、様々なアプリケーションを組み合わせることで、新次元の計測を実現しています。E3630は、次世代マスクなどのプロセス開発TAT短縮と生産性向上に貢献します。

\* : Multi Vision Metrology  
Scanning Electron Microscope  
(多次元観察・測長走査型電子顕微鏡)

#### 測定対象

- 最先端フォトマスク
- EUVマスク
- ナノインプリント用テンプレート
- パターンド・メディア

#### 先進の電子光学カラム設計

E3630の独自のカラム・デザインとユニークな電子ビーム走査技術は、従来システムE3620を踏襲しています。高い測定分解能を実現するために、カラム内部を高電圧に保つアドバンテスト独自のアーキテクチャーと新規に開発した対物レンズにより、色収差を大幅に低減し、低加速領域での分解能が一層向上しました。

MVM-SEMは、(株)アドバンテストの日本、米国およびその他の国における登録商標または商標です。

#### 高精度位置決め技術

E3630は、新型ステージ位置決めシステムにより、高いSEM倍率においても、安定して測定対象が画像センタに位置決めされるため、高スループット測定や容易な観察を実現しています。

#### 進化するマスクプロセスへの対応技術

E3630は、ハード・マスクプロセスなどの新しいマスクプロセスに対応するため、マルチチャンネル型の検出システムを搭載し、10nm以下の薄膜プロセスにおいても、安定かつ高精度な測定を実現しています。また、新しいエッジ検出アルゴリズムの組み合わせにより、Line/Spaceが入り組んだ複雑なパターンでも、LineとSpaceの誤認識の無い安定測定を提供でき、生産性向上に寄与します。

#### 豊富なアプリケーション

- SECS/GEM機能
- ホットスポット部の高精度計測機能
- SEM画像の輪郭抽出・GDS出力機能

#### データ、ジョブの互換性

E3630は、E3610/3620と完全互換のソフトウェア構成で、過去の資産の有効活用が可能です。



- 本製品を正しくご利用いただくため、お使いになる前に必ず取扱説明書をお読み下さい。
- 本カタログ記載の製品仕様および外観等は、予告なしに変更することがありますのでご了承下さい。

**ADVANTEST®**

<https://www.advantest.co.jp/>

株式会社 **アドバンテスト**

●お問い合わせは  
ナノテクノロジー事業本部  
〒349-1158 埼玉県加須市新利根1-5 埼玉R&Dセンタ  
TEL : 0480-72-6300  
E-mail : PDL-AT-info\_nano@advantest.com